(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59-128265

⑤ Int. Cl.³C 04 B 35/00

識別記号 108 庁内整理番号 6375-4G ④公開 昭和59年(1984)7月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 9 頁)

公高強度セラミツク成形体の製造法

②特 願 昭58-4472

22出

願 昭58(1983)1月14日

加発 明 者 田中卓

倉敷市酒津1625

仰発 明 者 丸山均

倉敷市西尾417-39

70発 明 者 岡谷卓司

長岡京市梅ガ丘2の46

⑫発 明 者 梶谷浩一

倉敷市酒津1652-1

⑪出 願 人 株式会社クラレ

倉敷市酒津1621番地

個代 理 人 弁理士 本多堅

明 細 譽

1. 発明の名称

高強度セラミツク成形体の製造法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) セラミック成形体を製造するに際し、パインダーとして(A) 炭素数 4 以上の炭化水素を有する疎水性基あるいは(A) と(B) イオン性親水性基とを側鎖に有する変性ポリビニルアルコールをセラミック粉末 1 0 0 重量部に対し 0.1~2 0 重量部用いることを特徴とする高強度セラミック成形体の製造法。
- (2) 炭素数 4 以上の炭化水素を有する疎水性基が脂肪酸ビニルエステル、アルキルビニルエーテル、Nーアルキル(メタ)アクリルアミド、ローオレフインよりなる群より選ばれる単量体の少なくとも一種の重合単位によつて生する疎水性基である特許請求の範囲第1項記載の高強度セラミック成形体の製造法。
- (3) イオン性親水性基がエチレン性不飽和カルボン酸、またはその塩もしくはその低級アルキル

エステル、酸無水物、エチレン性不飽和スルホン酸もしくはその塩より選ばれる単量体の少なくとも一種の重合単位によつて生ずるアニオン性親水性基である特許請求の範囲第 1 号記載の高強度セラミック成形体の製造法。

(4) イオン性親水性基が下記一般式(I) (III)で示される単量体の少なくとも一種の重合単位によつて生ずるカチオン性親水性基である特許請求の範囲第1項記載の高強度セラミック成形体の製造法。

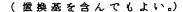
$$\begin{array}{c|c}
R_1 \\
+ CH_2 - C + \\
C - N - A - B \\
\parallel & \parallel \\
O & R_2
\end{array}$$
(I)

R. R.; 水素原子または低級アルキル基。

A; B中のN原子とアミド基のN原子を連結 する基。

$$B : -N < \underset{R_4}{\overset{R_5}{\sim}} \sharp \ \text{to it} \ -N^+ < \underset{R_6}{\overset{R_5}{\sim}} \cdot X^-$$

R₅, R₄, R₅; 水素原子または低級アルキル基



X⁻; アニオン・

$$- + CH_2 - CH +$$

$$R_e \xrightarrow{N} R_6$$

$$R_6$$

$$\begin{array}{c} CH_2 - CH \\ R_0 & N \\ \hline \\ R_7 & N^+ \\ R_9 & Y^- \end{array}$$

R₆, R₇, R₈, R₉; 水素原子、低級アルキル基ま たはフェニル基。

Y; アニオン

(5) プレス成形法により成形する特許請求の範囲 第 1 ~第 4 項記載のセラミツク成形体の製造法。 3. 発明の詳細な説明

本発明は、パインダーとして変性ポリビニルアルコール(以下「ポリビニルアルコール」を「PVA」と略記する)を用いることにより、高強度、高密度、高均質性のセラミック成形体を製造する方法に関するものである。さらに詳しくは、

用いる方法が提案されている。これらの方法を用いた場合には、成形面から考えると原料不純物に由来する可塑性物質の減少あるいは粒子表面積の増大を招き、より多量の有機パインダーが必要とされている。

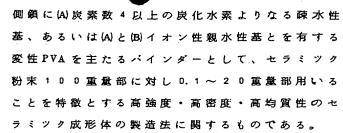
また、製品の大型化あるいは複雑化を成形面から考えると成形体(未焼結品)の取扱い時あるいは加工時に、より強度が強い成形体であることが必要とされる。従来技術ではこのような場合、有機パインダーの添加量を増す方法を採用している。

しかしながら、原料粉末に対する有機パインダーの添加割合を増すことは、下記の点で問題がある。

1. 脱パインダー操作における問題

成形体は焼結に先立つて脱パインダー操作を行なうが、この時有機パインダー量が多いと発熱量・発生ガス量が多くなるため、爆裂等による割れを生じるおそれがあり、脱パインダーに長時間を必要とする。

2 不純物等の混入の問題



セラミツクスは、近年その諸特性を生かして電子材料、磁性材料、光学材料、高温材料等幅広い用途に用いられている。これら種々の用途かれている。の例えば、熱的、電気的、機械的性質等のは、外の製品が望まれている。また機械部品、電気部品等の分野では、より複雑では、ないる。では、原料セラミック粉体のでいる。の表も成形方法の面からも成形方法の面からもある。

従来、セラミックス製品の熱的・電気的・機械 的・光学的諸性質を改善する方法として原料粉末 の純度を上げる方法あるいは微細な粒径の粉末を

有機パインダーの多量の添加は不純物の混入 あるいは成形物焼成後の炭化残渣の増大を招く ことがあり、かかる場合には製品純度を低下させる。

3. 寸法精度の問題

有機バインダー量が増すと、成形体を焼成した場合の収縮率が大きくなり、寸法精度の低下を招く。

これらの問題点を解決するために、種々のバインダーが検討されているが、低添加量で高強度、 高密度、高均質性の成形体を与えるバインダーは 現在まで見出されていない。

本発明者らは、種々の有機物のバインダー性能を検討した結果、仏炭素数4以上の炭化水素を有する疎水性基あるいは仏と旧イオン性親水性基とを有する変性PVAをバインダーとする場合水系 種類物調整時セラミック粉体との混和性が良く、種々の成形法において少量の使用で高強度の成形体が得られる事を見出し、本発明を完成するに至った。本発明の方法で得られる成形体はパインダー

量が少量であるため、成形体を焼成した場合焼成 による収縮率が小さく寸法精度が良い、焼成後の 密度が高く品質が良い等セラミック製品として非 常に多くの優れた点を持つていることが特徴であ

次に(A)炭素数 4 以上の炭化水素を有する疎水性基と(B)イオン性親水性基とを PVA の側鎖に含有せしめる方法としては、酢酸ビニルと前述の炭素数 4 以上の炭化水素基を有するエチレン性不飽和単量体とイオン性親水性基を有するエチレン性不飽

好ましい疎水性基の量は 0.5~ 1 0 モル劣である。

本発明において仏炭素数4以上の炭化水素を有する疎水性基をPVAの側鎖に含有せしめる方法としては炭素数4以上の炭化水素基を有するエチレン性不飽和単量体と酢酸ピニルとを共重合せしめてケン化する方法がまずあげられる。ここでエチレン性不飽和単量体としてはたとえばブチルピニルエーテル、ラウリルピニルエーテル、ステアリ

和単量体とを共重合せしめてケン化する方法があ げられる。

またカチオン性親水性基を有するエチレン性不 飽和単量体としては下記一般式(I) (II) (III) (III) で表わされ るエチレン性不飽和単量体があげられる。

$$CH_{2} = \begin{matrix} R^{1} \\ | \\ C \\ C \\ C \\ -N - A - B \\ | \\ | \\ C \\ R^{2} \end{matrix}$$
(I)

ただし、 R: 水素原子または低級アルキル基。 A: B中の窒素原子とアミド基の窒素原子を連 結する基。

R', R', R'; 水素原子或いは低級アルキル基。

$$\begin{array}{c} CH_2 = CH \\ \downarrow \\ R^3 & N \\ R^4 & N \end{array}$$

R⁴, R⁷, R⁸, R⁹; 水素原子或いは低級アルキル基 またはフェニル基。

Y-; アニオン

具体的には N ー(1, 1 ージメチルー 3 ージメチル アミノブロピル)アクリルアミド、トリメチルー 3 ー(1 ーアクリルアミドー 1, 1 ージメチルプロ ピル)アンモニウムクロライド、N ー(1, 1 ージ

けられる。

なおイオン性親水性基をPVAの側鎖に含有せしめるその他の方法としては、後変性により含有せしめる方法、たとえばPVAに硫酸、クロルスルホン酸などを反応させてエステル化する方法などもあげられる。

その他疎水性基およびイオン性親水性基をPVAの側鎖に含有せしめる方法としては、両者をともに後変性により含有せしめる方法、あるいは酢酸ビニルとイオン性親水性基を有するエチレン性不飽和単量体との共重合体ケン化物に疎水性基を後変性により含有せしめる方法などがあげられる。

本発明において使用される変性 PVA のけん化度については特に制限はなく、水溶性の範囲であればよい。 重合度は通常 100~ 3000 の範囲が適当である。

本発明の変性 PVA がパインダーとして適用された場合、そのパインダー特性が発揮される成形方法としてはプレス成形、押し出し成形、テープ成形、泥漿鋳込成形等の、水系混錬物を成形工程と

メチルー3ージメチルアミノブチル)アクリルア ミド、トリメチルー3ー(1 ーアクリルアミドー 3 ージエチルアミノブチル)アンモニウムクロラ イド、N-(1-メチル- 1,3-ジフェニル-3 ージエチルアミノプロピル) メタクリルアミド、 Ν-(3-ジメチルアミノプロピル)アクリルア ミド、トリメチルー3ー(1ーアクリルアミドブ ロピルアンモニウムクロライド、ジメチルアクリ ルアミドプロピルー4ートリメチルアンモニウム ブチェルー2ーアンモニウムクロライドー2ー(ア クリルアミドメトキシ)エチルトリメチルアンモ ニウムクロライドN-(3ージメチルアミノプロ ピル)メタアクリルアミド、トリメチルー3-(1 ーメタアクリルーアミドプロピル)アンモニウム クロライド、1ービニルイミダゾール、1ービニ ルー2メチルイミダゾール、1ーピニルー2ーエ チルイミダゾール、1ーピニルー2ーフエニルイ ミダゾール、1ーピニルー 2,3 ージメチルイミダ ゾール、1ーピニルー 2, 4,5 ートリメチルイミダ ソールおよびこれらイミダゾールの四級化塩があ

して持つ成形方法があげられる。ここで言う水系 混錬物とは、原料粉末と、水とパインダーからな り、必要に応じて解膠剤・可塑剤・滑剤等が添加 された系である。また、変性 PVA の溶解に問題と ならない程度の有機溶媒が存在してもよい。

特に、水系混錬物を適当な粒径の顆粒状に乾燥させ、これを適当な型材に供給し、加圧して成形するプレス成形においては、顆粒の潰れ易さ・圧力の伝達性が非常に問題になるが、本発明の変性PVAはそれ自体潤滑性があるためか、プレス成形には非常に効果が大きい。

本発明において使用される変性 PVA を粉体に使用する場合、粉体の種類、成形方法、成形物の形状等により、その適当な 添加量は異なるが、粉体100重量部に対し 0.1~20重量部好ましくは0.2~15 重量部の範囲で使用することで効果を発揮する。

本発明は上記変性 PVA をパインダーとして用いることに特徴があるが、解膠剤・潤滑剤等と併用してもよい。また、他のパインダーと併用しても

特開昭59-128265(5)

問題ない。ここで言う解膠剤とは通常用いられる -解膠剤で、例えば無機解膠剤としては、燐酸ソー ダ、苛性ソーダ、クエン酸ソーダ、リノール酸ソ - ダ等、有機物解膠剤としては、アミン類、ピリ ジン、ピペリジン、ポリアクリル酸の金属塩ある いはアンモニウム塩、ポリオキシエチレンノニル フェルルエーテル等である。一方、可盟剤として は例えばグリコール類、ポリエチレングリコール、 グリセリン、トリオール類等が使用される。また 滑剤としては通常用いられるもので、例えばみつ ろう、木ろう等天然ワツクス、パラフインワック ス、マイクロクリスタリンワツクス、低分子ポリ エチレン及びその誘導体等合成ワツクス、ステア リン酸、ラウリン酸等脂肪酸、ステアリン酸マグ ネシウム、ステアリン酸カルシウム等脂肪酸の金 属塩、オレイン酸アミド、ステアリン酸アミド等 脂肪酸アミド、ポリエチレングリコール等でこれ らが水系分散体になつていても良い。本発明で用 いられる変性PVAと併用して用いられるパインダ ーは何ら限定されない。例えば澱粉類、糖類およ

びそれらの誘導体、ゴム類、可溶性蛋白質類、セルロース誘導体、合成水溶性高分子としてPVA、ポリアクリル酸アミド、イソプチレンー無水マレイン酸共重合体、アクリル酸、メタクリル酸およびそれらのエステル化の単独あるいは共重合物等、水系分散体としてエチレン、ずロピレン等のオレフイン、酢酸ピニル等ピートン、アクリル酸、メタクリル酸はまたはニーテル、アクリル酸、メタクリル酸はまたはニーローテル、アクリル酸、メタクリル酸はまたはニーローテル、アクリル酸、メタクリル酸はまたはニーローテル、アクリル酸、メタクリル酸はまたはニーローテル、アクリル酸、メタクリル酸はまたは二個以上からなるポリマーの水系分散体等を用いることができる。

本発明の変性 PVA が適用されるセラミック粉末としては、セラミック製造に使用されうる金属または非金属の酸化物または非酸化物の粉末があげられる。またこれらの粉末の組成は単一組成、化合物の状態のものを単導または混合して使用してもさしつかえない。なお金属の酸化物または非酸化物の構成元素はカチオンまたはアニオンともに

単元素でもあるいは複数の元素から成り立つていてもよく、さらに酸化物または非酸化物の特性を改良するために加えられる添加物を含む系についても本発明に使用することができる。

具体的には Li、 K、 Be、 Mg、 B、 Al、 Si、 Cu、
Ca、 Sr、 Ba、 Zn、 Cd、 Ga、 In、ランタニド、 アクチニド、 Ti、 Zr、 Hf、 Bi、 V、 Nb、 Ta、 W、 Mn、
Fe、 Co、 Ni 等の酸化物、炭化物、窒化物、ホウ化物、硫化物等があげられる。また通常複酸化物と称せられる複数の金属元素を含む酸化物粉末の具体的なものを結晶構造から分類すると、ペロブスカイト型構造をとるものとして Na NbO3、 Sr Zr O3、 Pb Zr O3、 Sr TiO3、 Ba Zr O3、 Pb TiO3、 Ba TiO3、 等が、スピネル型構造をとるものとして Mg Al₂O₄、 Zn Al₂O₄、 Co Al₂O₄、 Ni Al₂O₄、 Mg Fe₂O₄ 等がイルメナイト型構造をとるものとしては Mg TiO3、 Mn TiO3、 Fe TiO₅ 等がガーネット型構造をとるものとしては Gd₃Ga₅O₁₂、 Y₅ Fe₅O₁₂ 等があげられる。

本発明に用いられる変性 PVA は上記セラミック 粉末の粒径および形状によらず有効であるが、粉

これらのセラミツク粉末のうち、酸化物粉末とりわけ電子材料、磁性材料、光学材料、高温材料等を製造するための金属酸化物粉末に対して本発明で用いられる変性 PVA が好適に使用される。

このようにして得られる本発明の成形物を通常 の条件で焼成することにより強度などの優れた磁 器が得られる。

以下に本発明を実施例、比較例によりより詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例に限られるものではない。なお、実施例中の部は特に表示しない限り重量部を示す。

以下余司

実施例1

変性 PVA(A) の製造

** 酢酸ビニル 7 7 0 部、メチルア ルコール 1 3 7 0 部、ラウリルビニルエーテル 2 5.1 部を重合缶に仕込んで常法により重合し、未反応の酢酸ビニルを追出し、ついで苛性ソーダを触媒としてケン化した。

得られた PVAをピリジン媒体中でクロルスルホン酸を反応させたのち、中和して変性 PVA(A)を得た。分析結果より該変性 PVA はラウリルエーテル基を 0.9 モル%含有し、スルホン酸エステル基を 1.0 モル%含有し、ケン化度 99.1 モル%、20℃における 4 %水溶液粘度が 10 センチポイズであった。

プレス成型

アルミナ粉末(99.8 % 純度)100 部、水100 部に、ポリアクリル酸アンモニウム塩を解こう剤 として 0.3 部加えて 9 0 時間ボールミルで粉砕し た後、変性 PVA(A) 水溶液を固形分で 2 部、ステ アリン酸エマルション 1.5 部、グリセリン 1 部を 粉体と均一混合した。このスラリーを噴霧乾燥に

酢酸ビニル 2 1 0 0 部、平均炭素数が 1 0 の分岐 状脂肪酸ビニルエステル(シエル化学製、 VeoVa - 1 0) 5 5 部、メチルアルコール 3 6 0 0 部、 ア リルスルホン酸ナトリウム 5 8 部を用い常法によ り重合し、未反応の酢酸ビニルを追出し、得られ た重合体俗液を常法により苛性ソーダを触媒とし でケン化した。得られた変性 PVA(B) は炭化水素 基(バーサチック酸エステル部)を 1.2 モル%、 スルホン酸基を 2.0 モル%含み、ケン化度 97.8 モ ル%、 2 0 ℃における 4 %水溶液粘度が 7 センチ ボイズの変性 PVAであつた。

(プレス成形)

アルミナ(9 9.8 % 純度) 100 部、水 5 0 部、ポリアクリル酸アンモニウム塩解こう剤 0.3 部、をボールミルで 9 0 時間粉砕した後、変性 PVA (B) 水溶液を固形分で 2 部添加し粉体と均一に混合した。 このスラリーから顆粒(粒径 100 ± 2 0 μ)を調整し、巾 2 0 mm 長さ 100 mm 厚さ 1 0 mm の直方体を金型で加圧(1.2 ton/cml)して成形した。評価結果を表 1 に示す。

より造粒を行なつた。得られた造粒品(顆粒)は流動性が良好で、真球に近い球体であつた。この顆粒を用いて静水圧プレスによつて内径15 mmの円筒状の成形体を得た。この時、成型用型材への付着は起らず、離型は窓のであった。得られた成形体の表面を顕微鏡観察したあった。 顆粒は十分つぶれていた。成形体の鏡を曲げ試験で評価したところ、後述する比較1の未変性 PVAをバインダーとした場合よりも非常に強度が強かつた。またこの成形体の切削加工、ドリル加工も容易であつた。

比較例 1

実施例 1 の変性 PVA(A)の代りに未変性 PVA(クラレポパール 217)を用いる以外は、実施係 1 と同様にして行なつた。前述したように実施例 1 の変性 PVA(A)を用いたものに較べてはるかに強度は弱かつた。また成形体の切削加工、ドリル加工は困難であつた。

実施例2

変性 PVA(B)の製造

比較例2

実施例2のバインダーの代りに未変性 PVA(クラレボバール 205)メチルセルロース、酢酸ビニルエマルジョンを用いて、それぞれ成形した。評価 結果を表1に示す。

実施例3

実施例2の変性PVAの製造法に準じて各様の変性を行ない、変性PVA(e)~(点)を作成し、バインダーに供した。成形は実施例2と同様に行なつた。評価結果を表1にまとめて示す。

以下余白

	試料	1129-		変 性 PVA				成形性		成形体強度*	
	番号	1		棘水性基導入単量体	親水性基準入単量体	疏水性基量	親水性基盘	離型性	均質性	(タフネス)	加工性**
実施例 2	3	変性PVA	(B)	Veova - 10	アリルスルホン餃ナトリウム	1.2 €1/96	2.0 €1196	0	0	5, 0	0
実施例 3	4	•	(C)	Veova — 10	イタコン酸	8,7	0	0	0	1, 1	
	5	-	(D)	-	•	1.0	1.0	0	0	1,5	0
	6	-	(E)	-	,	3.0	1.0	0	0	5.9	0
	7	-	(F)	~	•	4.0	3.0	0	0	8.5	0
	8	-	(G)		•	4.0	6.0	0	0	6, 0	0
	9	~	(H)	ヘプテン	無水マレイン酸	2.0	1,0	0	0	1,3	0
	10		(1)	ステアリルビニルエーテル	•	1.2	1,0	0	0	2.1	0
	11	-	(1)	Veova - 10	トリメチルー3-(1-メタクリルアミド ープロピル)アンモニウムクロリド	2.0	1,0	0	0	2.3	0
	12		(K)	オクチルアクリルアミド	無水マレイン酸	3.0	1.0	0	0	2.8	0
比較例 2	13	P V A - 205						0	×	1,0	Δ
	14	メチルセルロー	z.					Δ	×	1.0	Δ
	15	酢酸ピニルエマ	ルジョン					Δ	×	0.3	×

表 1 パインダーと成形性・成形体物性

- * 成形体強度は三点曲げ試験にて行ない,成形体が折れるに必要なエネルギー(タフネス)を s s カーブから求め, PVA 205を バインダーとした時の成形体のタフネスを 1.0 として相対値で求めた。
- ** 加工性はナイフによるカンテイング、ドリルによる孔開けを行ない、その難易度を評価した。 ○:容易に加工できる。 △:加工が闲難である。 ×:加工が非常に難かしい。

手 続 補 正 暋 (自発)

昭和 59年 4 月 2 日

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿 事件 の 表 示

特顯昭 58-4472号

※2. 発明の名称

高強度セラミツク成形体の製造法

 補正をする者 事件との関係

特許出願人

倉 敷 市 酒 津 1 6 2 1 番 地

(108) 株式会社 ク ラ レ 代表取締役 上 野 他 一

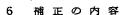
4. 代 理

倉 敷 市 酒 輝 青 江 山 2 0 45の1 株式会社 ク ラ レ 内 電話 倉敷 0864 (25) 9 3 2 5 (直通)

電話 倉敷 0864 (25) 9 3 2 5 (直辺) (6747) 井 理 土 本 多 堅 (東京連絡先) 株式会社クラレ特許部 理 話 東 京 0 3 (277) 3 1 8 2

5. 補正の対象

明細書の特許請求の範囲の機等許许 発明の詳細な説明の欄 59.4.4



- (1) 特許請求の範囲を別紙のとおり補正する。
- (3) 同第9 頁第9~10行の「平均炭素数が10 の分岐状脂肪酸ビニルエステル(シエン化学製 VeoVa-10)」を「分岐状脂肪酸ビニルエステル (たとえばシエル化学製の「VeoVa-10」)」と 補正する。
- (4) 同第11頁第1行の「R¹;」を「R¹, R²;」と補 正する。
- (5) 同第 1 1 頁の第 4 行の「N< R⁴」を「-N< R⁴」と簡正する。
- (6) 同第11 頁ドから第4 行~第1 3 頁第 1 行の 「具体的には…… あげられる。」を次のとおり 補正する。

「具体的にはN-(1,1-ジメチル-3-ジ メチルアミノプロピル)アクリルアミド、トリ メチル-3-(1-アクリルアミド-1,1-ジ

メチルプロピル)アンモニウムクロライド、 N - (1, 1 - ジメチ ルー 3 - ジメチ ルア ミノブチ ル) アクリルアミド、トリメチルー3ー(1-アクリルアミドー 1, 1-ジエチルアミノブチル) アンモニウムクロライド、N-(1-メチルー 1.3 - ジフエニル - 3 - ジエチルアミノプロピ ル) メタクリルアミド、 N - (3 - ジメチルア ミノプロピル) アクリルアミド、トリメチルー 3 - (1-アクリルアミドプロピルアンモニウ ムクロライド、N-(3-ジメチルアミノプロ . ピル) メタアクリルアミド、トリメチルー3ー (1-メタアクリルーアミドプロピル)アンモ ニウムクロライド、1ーピニルイミダゾール、 1 - ピニルー2メチルイミダソール、ゴービニ ルー 2 ーエチルイミダゾール、1 ーピニルー 2 ーフエニルイミダゾール、1-ピニルー 2,4-ジメチルイミダソール、1-ビニルー 2, 4, 5 -トリメチルイミダソールおよびこれらイミダソ ールの四級化塩があげられる。」

(7) 同第21頁第1~第3行の「平均炭素数が…

…… 5 5 部」を「分岐状脂肪酸ビニルエステル {シエル化学製の「VeoVa-10」;

 $(ただし<math>R^1$, R^2 および R^3 はいづれもアルキル基を示し、 R^1 , R^2 および R^3 中の炭素数の合計量は8個である。) $\}$ 5 5 部」と補正する。

特許請求の範囲

- (1) セラミック成形体を製造するに際し、バインターとして(A) 炭素效 4 以上の炭化水素を有する 疎水性基あるいは(A) と(B) イオン性親水性基とを 側鎖に有する変性ポリビニルアルコールをセラ ミック粉末100重量部に対し0.1~20重量 部用いることを特徴とする高強度セラミック成 形体の製造法。
- (2) 炭素数4以上の炭化水素を有する竦水性基が脂肪酸ピニルエステル、アルキルビニルエーテル、Nーアルキル(メタ)アクリルアミド、ローオレフインよりなる群より選ばれる単量体の少なくとも一種の置合単位によつて生ずる疎水性基である特許請求の範囲第1項記載の高強度セラミック成形体の製造法。
- (3) イオン性親水性基がエチレン性不飽和カルポン酸、またはその塩もしくはその低級アルキルエステル、酸無水物、エチレン性不飽和スルホン酸もしくはその塩より選ばれる単量体の少なくとも一種の重合単位によつて生ずるアニオン

性親水性基である特許請求の範囲第1項記載の高強度セラミック成形体の製造法。

(4) イオン性親水性基が下記一般式(1)(II) III で示される単量体の少なくとも一種の重合単位によつて生ずるカチオン性親水性基である特許請求の 範囲第1項記載の高強度セラミック成形体の製造法。

R1, R2; 水岩原子または低級アルキル基。

A; B中のN原子とアミド基のN原子を連結 する基。

Ra, Re, Rs; 水素原子または低級アルキル基 (置換基を含んでいてもよい)

$$X^-$$
; $r = \pi \nu$

$$CH_{2} = CH$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

Re. Rr. Ra, Re; 水素原子、低級アルキル基ま たはフエニル基。

 Y^- ; $r = x \sim$

(5) プレス成形法により成形する特許請求の範囲 第1~第4項記載の<u>高強度</u>セラミック成形体の 製造法。